

2026年3月期 上半期
[2025年4月～2025年9月]

決算説明会

2025年11月12日(水)



INDEX

第一部：会社概要

代表取締役 社長執行役員 CEO 二ノ宮 照雄

第二部：2026年3月期上半期業績

取締役 執行役員 CFO 糸雅 誠一

第一部：会社概要



テクセンドフォトマスク(TPC)は、外販フォトマスク(PM)のグローバルリーディングベンダーとして、高成長の半導体バリューチェーンにおいて不可欠な製品を提供し、技術革新及び社会の持続的な進化を支えております

60+

年の歴史

長年にわたるお客様との関係

16.4%

売上高CAGR^{*1}
(FY21 - FY24)

継続的な需要増加に伴う高い成長率

37.1%

調整後EBITDAマージン^{*2}
(FY22 - FY24)

効率的かつ安定したビジネスモデル
に伴う高い収益性

38.9%

外販フォトマスク市場でNo.1シェア
(売上高ベース)^{*3}

2020年以降、
市場シェアを7.5%拡大^{*4}

87%

ロジック比率
(メモリ以外)^{*5}

ロジック比率の高さ
に伴う魅力的な成長プロファイル

8

製造拠点^{*6}

主要地域において7カ国、
1,869人の従業員^{*7}

注：

*1：財務数値は、TOPPANホールディングスからのカーブアウト前のFY21は管理会計ベース、FY22、FY23、FY24はIFRSベースであるため、FY22、FY23、FY24の売上高はFY21の売上高と直接比較できないもの
*2：調整後EBITDA = 親会社株主に帰属する当期利益 + 法人所得税費用 - 金融収益 + 金融費用 + 減価償却費および償却費 + 減損損失 + スタンドアローン・上場準備費用 + 株式報酬費用 + 資本再編の検討に要した費用。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDA ÷ 売上高で計算
*3：SEMI "2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY"。38.9%はCY2024の売上高ベースのシェア
*4：売上高ベース、CY2016-CY2024。SEMI "2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY"
*5：FY25上半期の売上高ベース
*6：2025年9月30日時点のデータ
*7：2025年3月31日時点のデータ

*3：SEMI "2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY"。38.9%はCY2024の売上高ベースのシェア
*4：売上高ベース、CY2016-CY2024。SEMI "2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY"
*5：FY25上半期の売上高ベース
*6：2025年9月30日時点のデータ
*7：2025年3月31日時点のデータ

*3：SEMI "2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY"。38.9%はCY2024の売上高ベースのシェア
*4：売上高ベース、CY2016-CY2024。SEMI "2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY"
*5：FY25上半期の売上高ベース
*6：2025年9月30日時点のデータ
*7：2025年3月31日時点のデータ

テクセンドフォトマスク - 多角的な事業展開と経営陣

会社概要

TOPPAN

1961

- PMの試作に成功

2005

- デュポン・フォトマスクの全株式を取得

TOPPAN
TOPPAN PHOTOMASK

2022

- インテグラルとのJVにより、IC PMの
ピュアプレイ・ベンダーとして確立

TEKSCEND
PHOTOMASK

2024

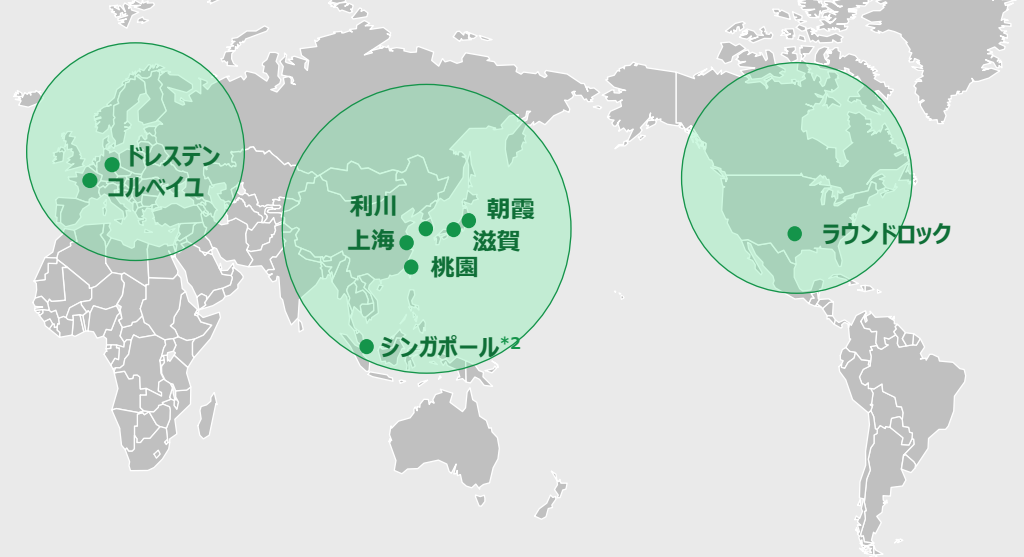
- "テクセンドフォトマスク" にリブランド

TEKSCEND
PHOTOMASK

2025

- 10/16 :
東京証券取引所、プライム市場に上場

グローバルな製造拠点 - 8拠点が主要地域をカバー*1



マネジメント



二ノ宮 照雄
CEO
日本



糸雅 誠一
CFO
日本



Michael G. Hadsell
COO
(米国・欧州)



Chan-Uk. Jeon
CTO
(米国・欧州)



飯島 伸之
CHRO
日本



石松 忠
アジア事業統括
(アジア)



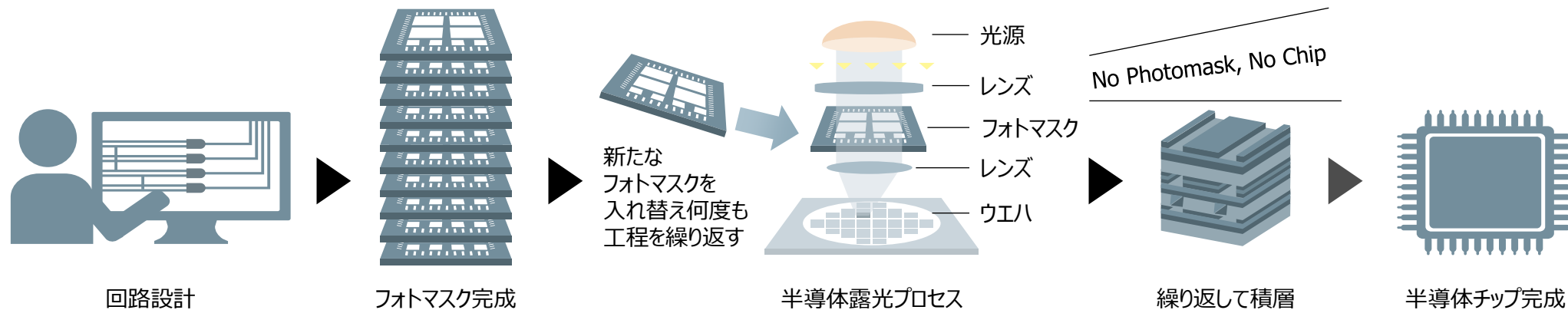
Arthur Kuo
CBO
(アジア)



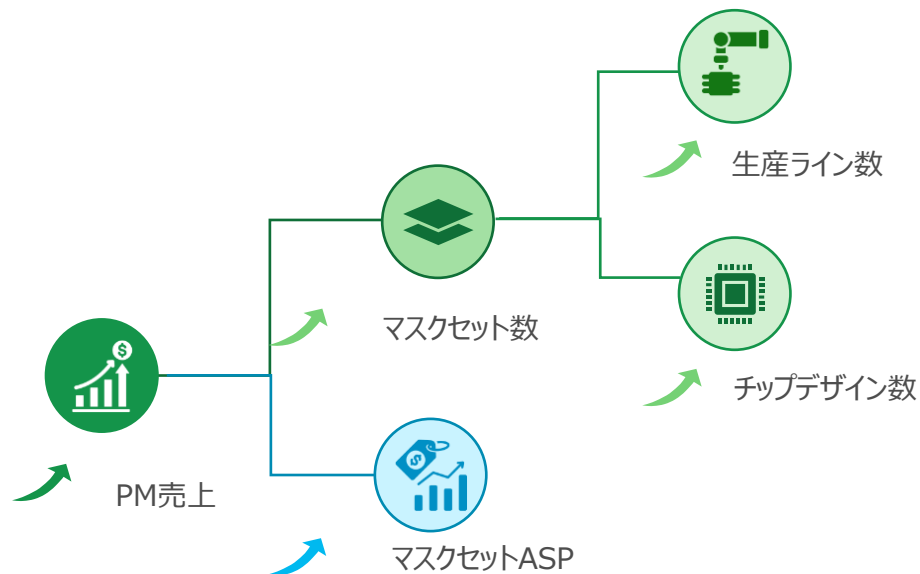
Andrew Liu
Deputy CFO
(アジア)

半導体フォトマスクの使用方法和市場の成長構造

半導体フォトマスクの使用方法



半導体フォトマスク市場の成長構造



1. 顧客工場／生産ライン数の増加

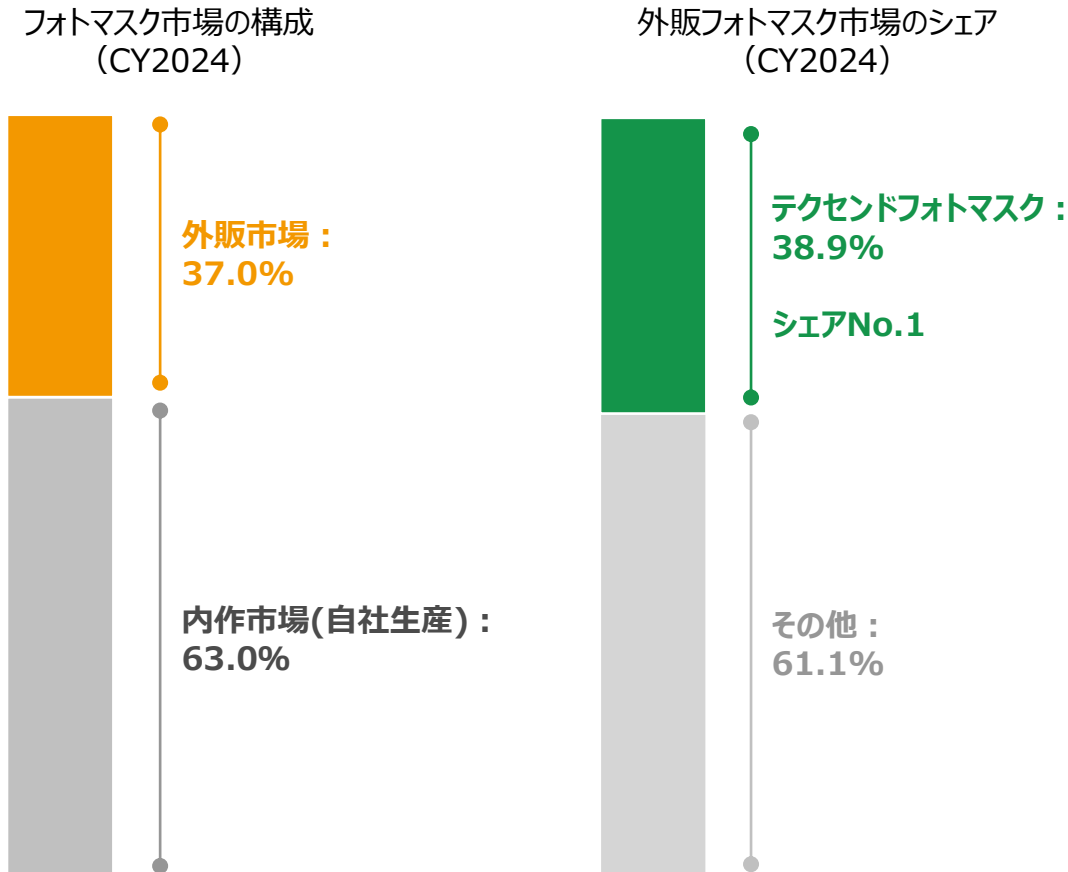
2. 半導体デザイン数の増加／多様化

3. 微細化に伴う必要マスク枚数の増加／ASP(セット単価)の上昇

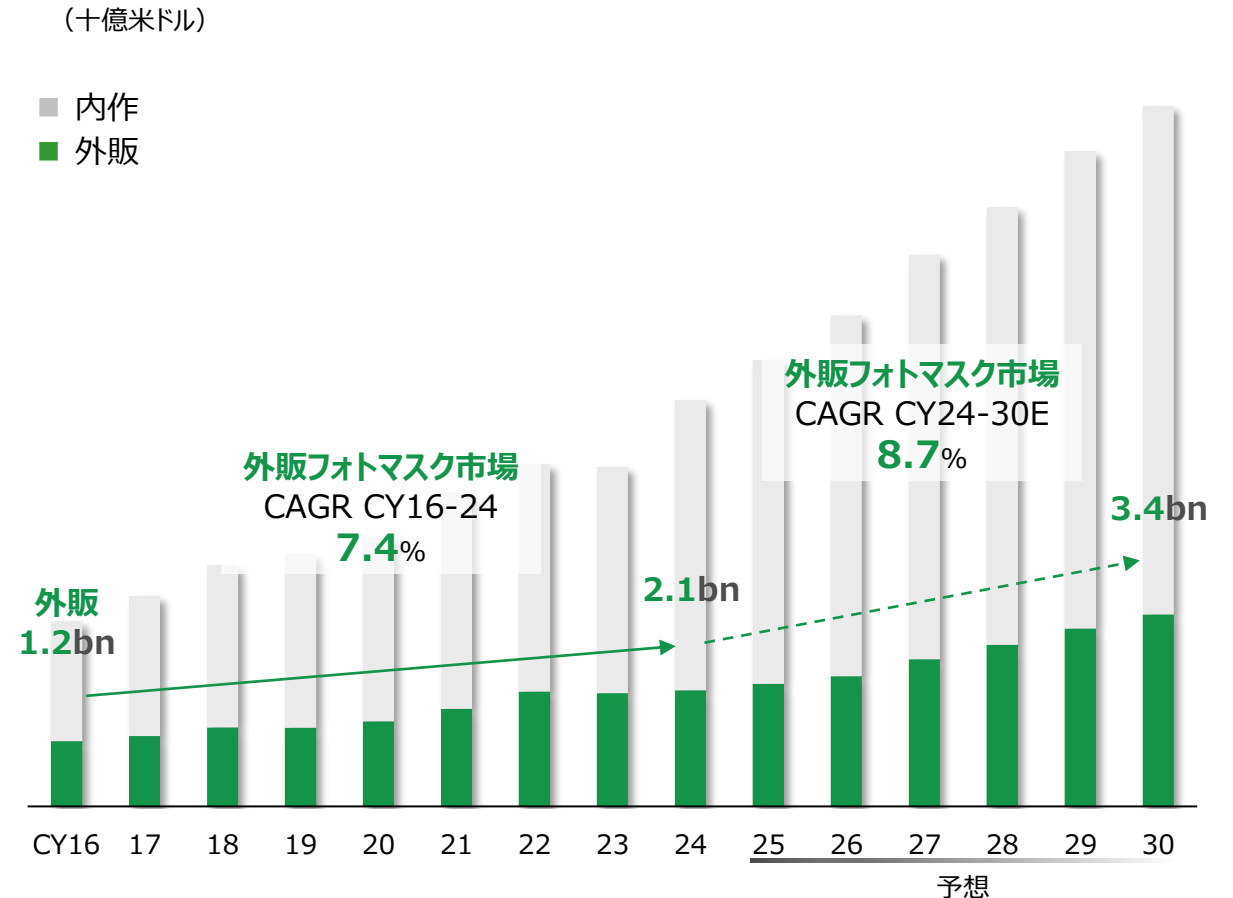
フォトマスク市場の概況

- フォトマスク市場は内作（自社生産）市場と外販市場に分けられ、当社は**外販市場にてシェアNo.1**を獲得しております
- 内作プレイヤーは最先端領域の開発と量産に注力しており、先端～成熟領域を外注する傾向にあります

半導体フォトマスク市場の概況*1



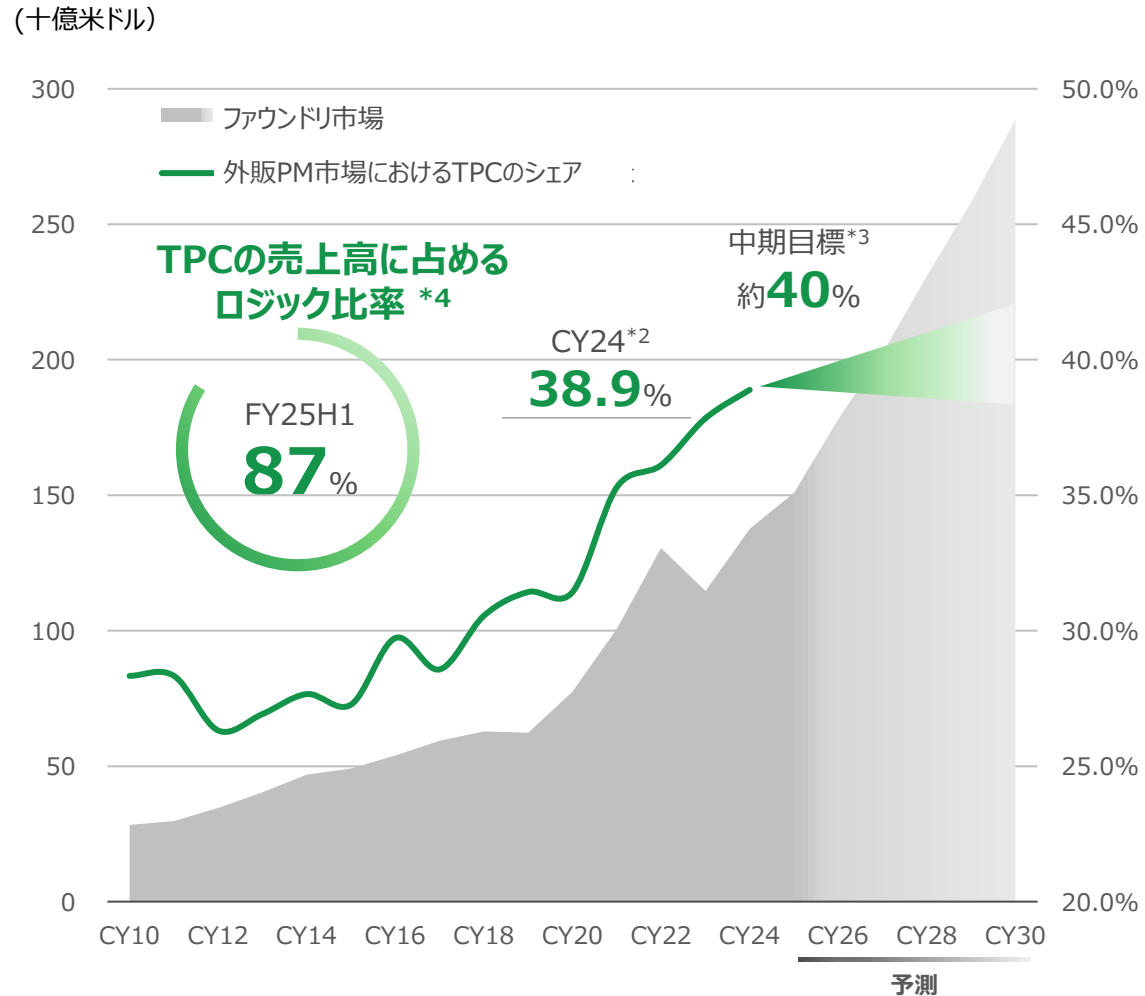
外販フォトマスク市場の推移*2



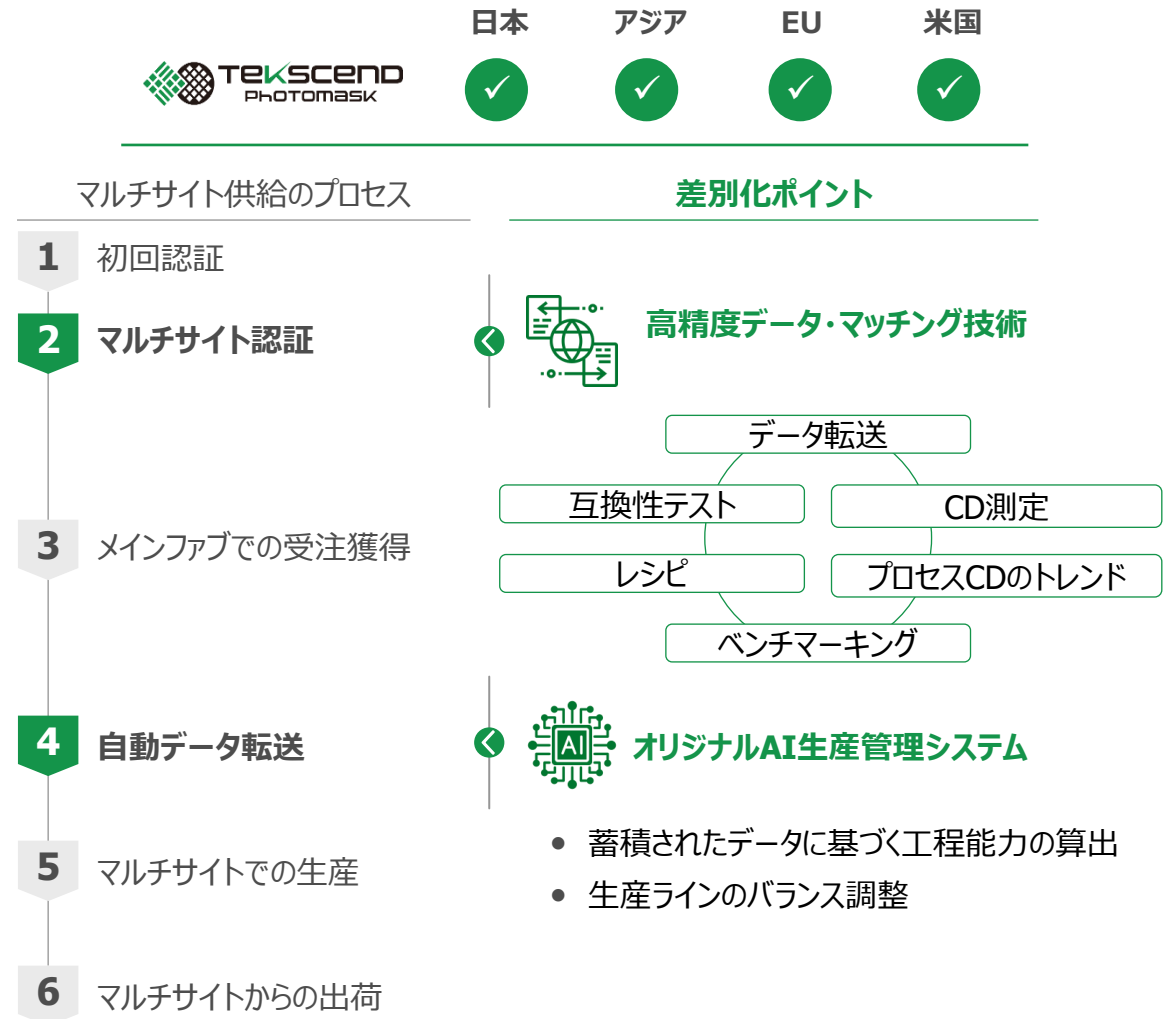
注：
*1：SEMI "2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY"
*2：当社が委託した第三者ベンダーによる調査に基づく市場データ

ファウンドリの成長によるシェア拡大とグローバルな生産体制

ファウンドリ市場の成長を追い風に、シェア拡大を目指す*1



1つのグローバル工場のようなマルチサイト供給



注：

*1：このグラフは、異なる2つのソースからデータを組み合わせて作成。ファウンドリ市場の売上高：“Gartner Semiconductor Foundry Worldwide”。TPCの外販市場シェア：SEMI “2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY”。ロジック/ファウンドリの比率は企業情報（売上高ベース）に基づく

*2：SEMI “2024 PHOTOMASK CHARACTERIZATION STUDY”。38.9%はCY2024の売上高ベースのシェア

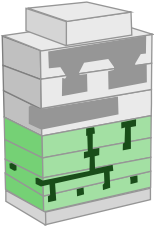
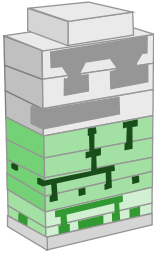
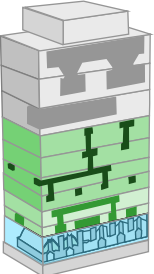
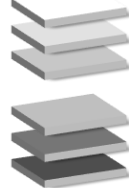
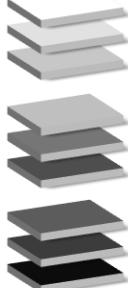
*3：会社情報に基づく

*4：2026年3月期上半期の売上高における、ロジック比率

微細化に伴う必要マスク枚数の増加／付加価値向上

- 先端半導体向けのマスクセットは、より多くのマスク枚数と複雑な構造が求められます
- マスクセットのASPは微細化と技術革新に伴い継続的に上昇する傾向にあります

(チップ／マスクセットの構造)

ノード	130-110nm	90-40nm	28-7nm
チップ			
マスクセット			
PMシート数*1	35-40	40-55	50-80

主要トレンド

微細化
(複雑化)



マルチパターニング



PMのシート/レイヤーの増加

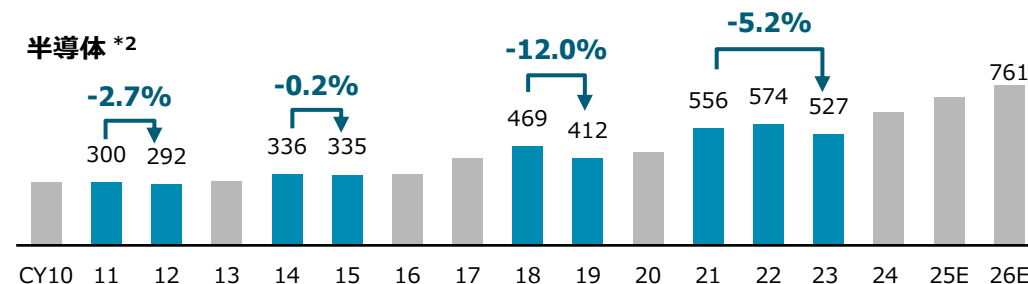
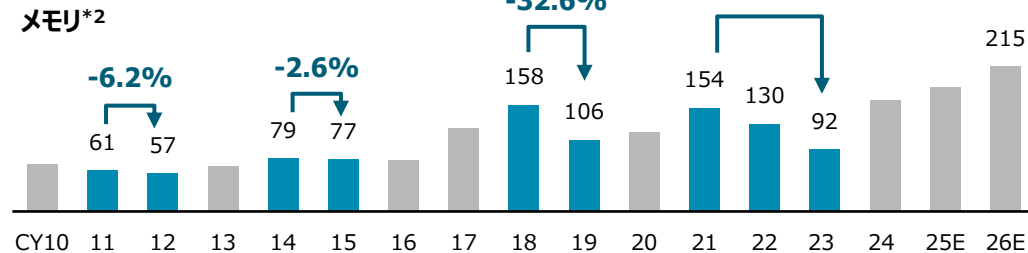
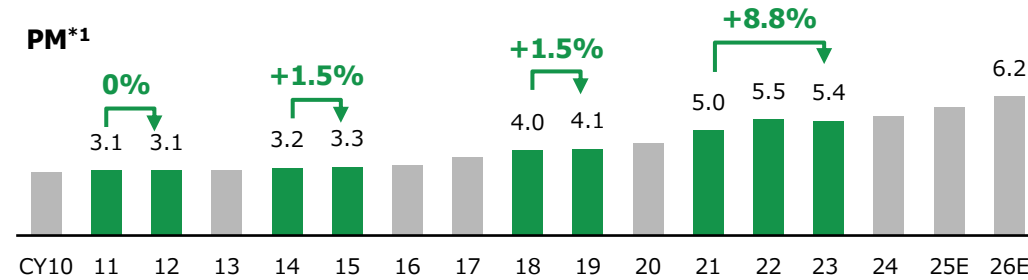


価格上昇 (ASP)

特筆すべきフォトマスク市場の安定性

- フォトマスク市場は、メモリや半導体市場よりもシリコンサイクルの影響を受けにくい傾向があります
- 加えて、1)ロジックを中心とした売上構成、 2)安定したビジネスモデルに支えられ、構造的な安定性を有しています

市場規模 (十億米ドル)*1



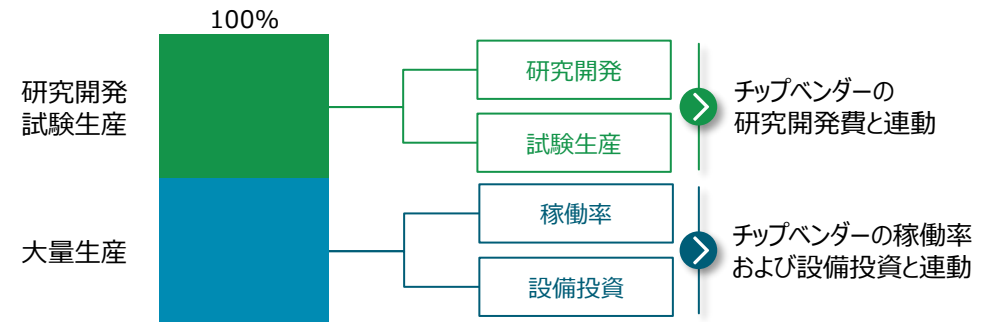
安定性を実現する主な要因

1. 強力な価格環境

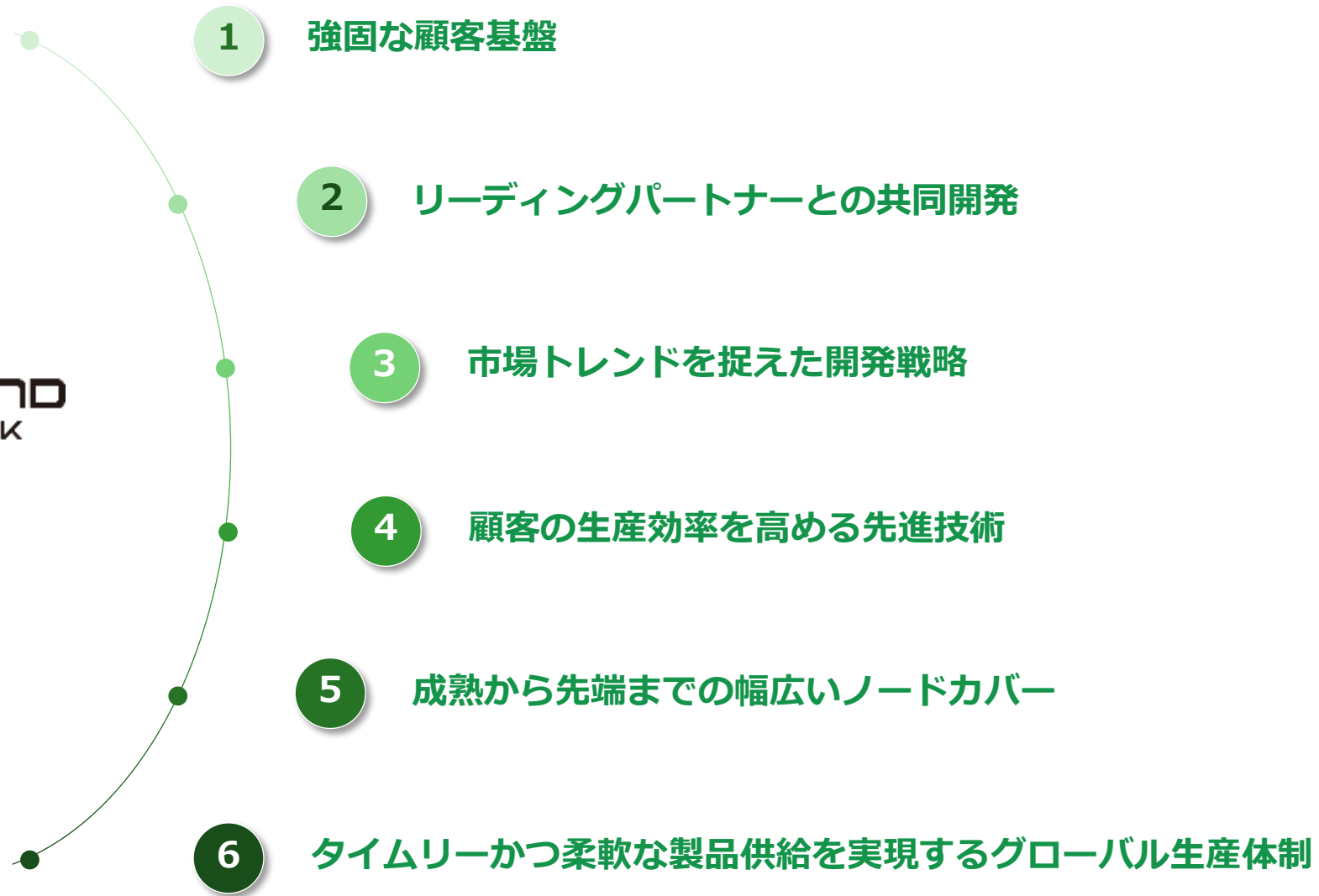
-  寡占的な業界構造と強い価格交渉力
-  重要性の高さから、価格よりも品質が重視される傾向
-  次世代への継続的な移行に伴うASPの構造的な上昇

2. 安定性の高いビジネスモデル

-  技術革新に伴う研究開発／試験生産需要の堅調な推移



-  受注生産モデルによる在庫リスクの限定
-  ロジック向けの安定した需要



中期事業目標

	FY22	FY23	FY24	中期目標
売上収益成長率 (YoY)	-	6.3%	10.2%	約10% (CAGR)
売上総利益率	39.4%	29.5%	34.9%	-
営業利益率	28.5%	18.5%	23.9%	約20%
EBITDA マージン*1	37.3%	33.8%	37.3%	約40%

注：
 *1：FY22、23、24のEBITDAマージンの算出においては、EBITDAを使用。EBITDA=親会社株主に帰属する当期利益+法人所得税費用-金融収益+金融費用+減価償却費及び償却費。EBITDAマージンはEBITDA÷売上高で算出

第二部：2026年3月期上半期業績

売上収益

半導体市場はAI・クラウド関連製品の需要が強く、微細化も進展
外販フォトマスク市場の成長：

- ・ 内作プレイヤーのリソースは最先端ノードに集中しており先端ノードを外販化する傾向が継続
- ・ 半導体市場の需要に支えられ、ファウンドリ向けは前年同期と比較して先端品・基幹品ともに堅調に推移

売上収益成長率

2026年3月期上半期の売上高は前年同期比円ベースで3.8%増加
USドルベースでは8.3%(参考値)増加

営業利益率

2026年3月期上半期の営業利益率は20.9%(前年同期比4.1ポイント減)
主な変動要因は、先行投資に伴う減価償却費の増加や上場に伴う一過性費用の増加

EBITDAマージン

2026年3月期上半期のEBITDAマージンは35.6%（前年同期比1.8ポイント減）
調整後EBITDAマージンは36.1%(参考値)

投資分析

成長ドライバーである先端ノード向けの投資に注力
シンガポールに製造拠点を新設

財務ハイライトと分析 - 概況

- 売上収益は為替影響あるも堅調に推移し増収
- 材料費増加、上場に伴う費用増加等により、営業利益は減益

	2025年3月期 上半期	2026年3月期			増減率	
		第1四半期	第2四半期	上半期	直前四半期比 FY25Q2 対 FY25Q1	前年同期比 FY25H1対 FY24H1
	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)		
売上収益	59,516	30,076	31,695	61,771	+ 5.4%	+ 3.8%
売上総利益	21,226	9,811	11,088	20,900	+ 13.0%	▲ 1.5%
売上総利益率	35.7%	32.6%	35.0%	33.8%	+ 2.4pt	▲ 1.9pt
営業利益	14,878	5,875	7,020	12,896	+ 19.5%	▲ 13.3%
営業利益率	25.0%	19.5%	22.2%	20.9%	+ 2.7pt	▲ 4.1pt
四半期/中間利益	8,728	5,475	6,874	12,350	+ 25.6%	+ 41.5%
親会社の所有者に帰属する 四半期/中間利益	8,728	5,475	6,874	12,350	+ 25.6%	+ 41.5%
EBITDAマージン	37.4%	33.8%	37.3%	35.6%	+ 3.5pt	▲ 1.8pt
調整後EBITDAマージン※	37.6%	34.2%	37.9%	36.1%	+ 3.7pt	▲ 1.5pt
研究開発費率	0.8%	0.9%	0.9%	0.9%	+ 0.0pt	+ 0.1pt
減価償却費率	12.0%	13.9%	14.7%	14.3%	+ 0.8pt	+ 2.3pt
為替レート(USD/JPY)	152.45円	143.75円	148.34円	146.07円		

【参考値(KUSD)】

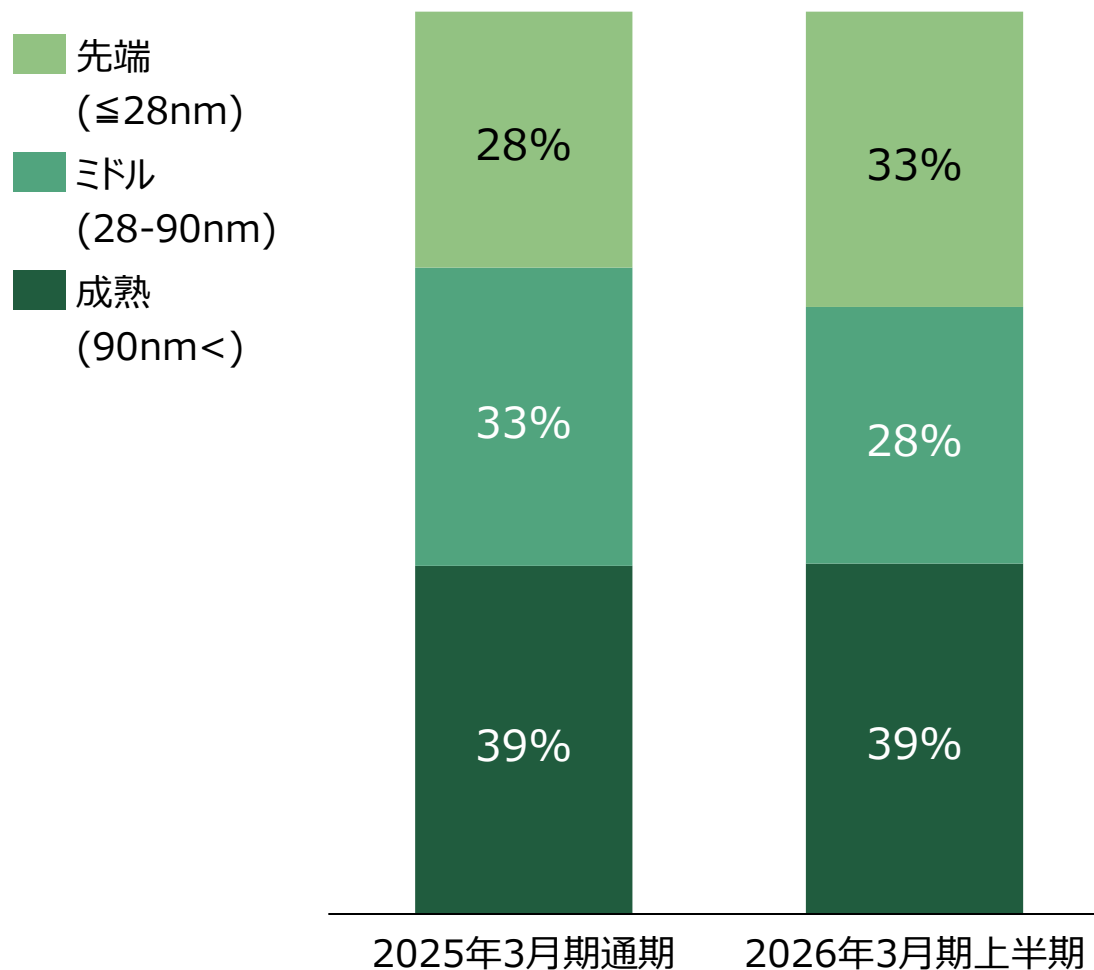
売上収益	390,397	209,224	213,665	422,886	+ 2.1%	+ 8.3%
売上総利益	139,233	68,250	74,747	143,082	+ 9.5%	+ 2.8%

※調整後EBITDA = 当期(四半期)利益 + 法人所得税費用 + 減価償却費及び償却費 + 減損損失 + スタンドアローン・上場準備費用 + 株式報酬費用 + 資本再編の検討に要した費用。 EBITDA = 親会社株主に帰属する当期利益 + 法人所得税費用 - 金融収益 + 金融費用 + 減価償却費及び償却費。 EBITDAマージンはEBITDA ÷ 売上高で算出

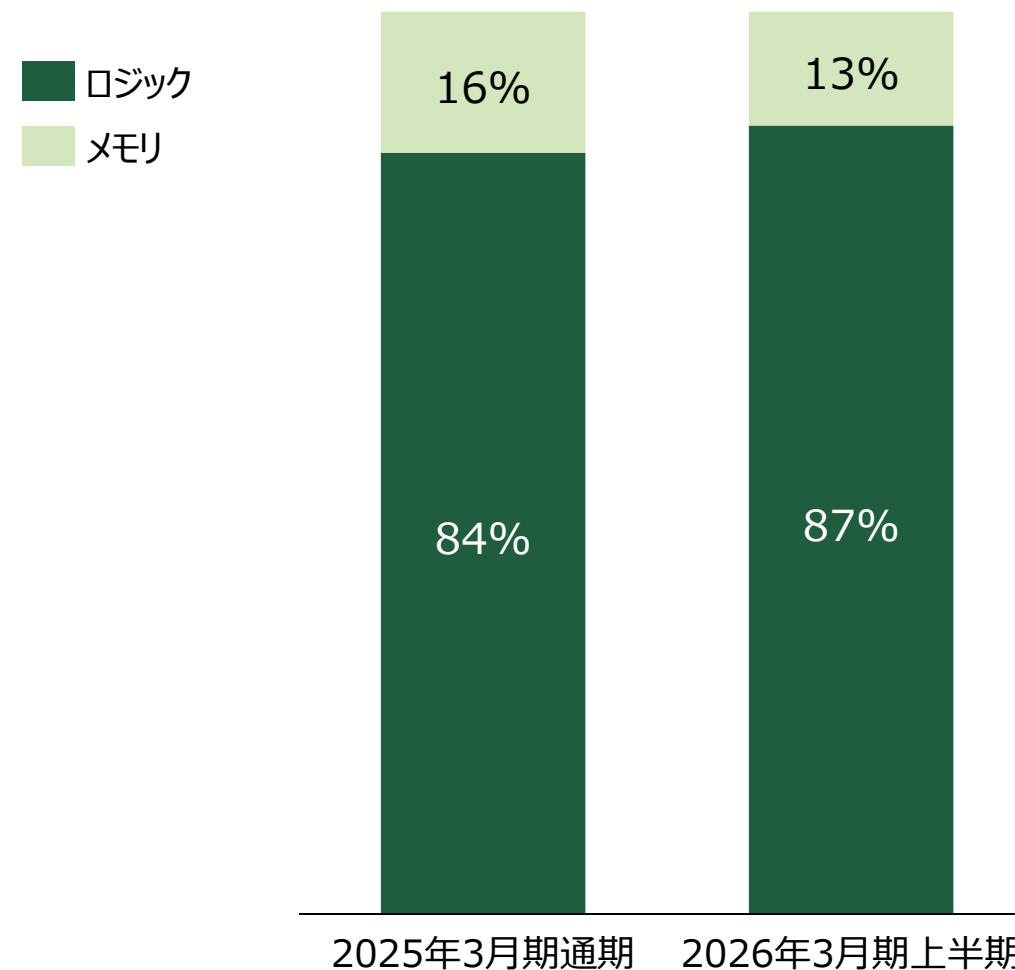
売上構成（プロセスノード別 / アプリケーション別）

- EUV含む先端ノード、特にロジック向けを中心に、高成長かつ安定した収益拡大を目指す方針
- 当社にとって競争優位性のある先端ノードの売上構成比率拡大を推進

売上構成（プロセスノード別）



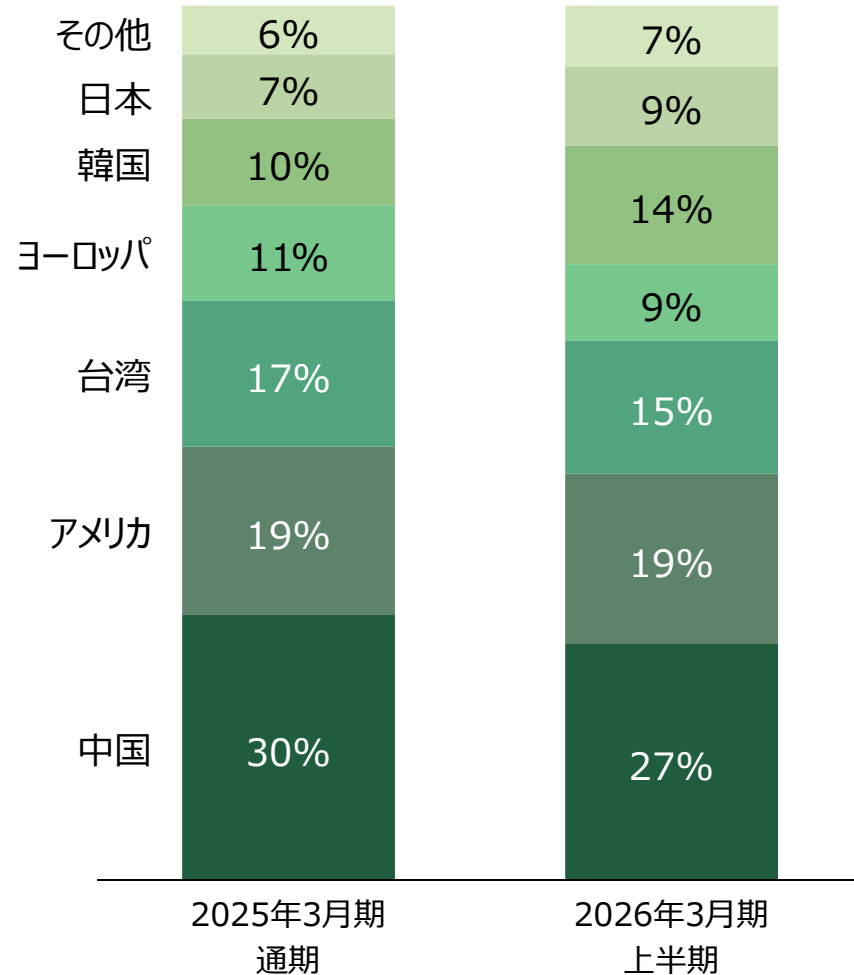
売上構成（アプリケーション別）



売上構成 – 地域別(仕向け地)

- 韓国は+4ポイント、日本は+2ポイント、中国は▲3ポイントで着地

売上構成（地域別）※



売上分析(2025年3月期通期 vs 2026年3月期上半期)

- 日本
最先端ノードの取り込みによる受注増加
- 韓国
先端ノードの需要増を取り込み、受注増加
- 中国
ローカルフォトマスクベンダーとの競争激化

成長戦略

- 日本
EUVマスクの量産ライン確立
- シンガポール
現地で増加するフォトマスクの需要を取り込むため、新工場を設立
- 米国
地政学、関税リスクを要因とした国内回帰を背景に、半導体需要が拡大これに伴い増加しているフォトマスク需要に対応するため、生産増強
- 中国
高収益かつ技術的な参入障壁の高い先端ノード中心とした製品ミックスへのシフトを目指す

連結業績状況 - 2026年3月期上半期BS

- 当中間会計期間における総資産は、有形固定資産、その他の金融資産、未収法人所得税等が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ19,616百万円増加
- 負債は、営業債務及びその他の債務が減少したものの、借入金、その他の金融負債が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ4,895百万円増加
- 自己資本比率は、70%台と安定推移

2025年3月末 資産・負債・資本

単位：百万円※	
総資産 167,752	
流動資産 64,082	流動負債 33,314
	非流動負債 18,055
非流動資産 103,669	資本 116,381
	(自己資本比率 69.4%)

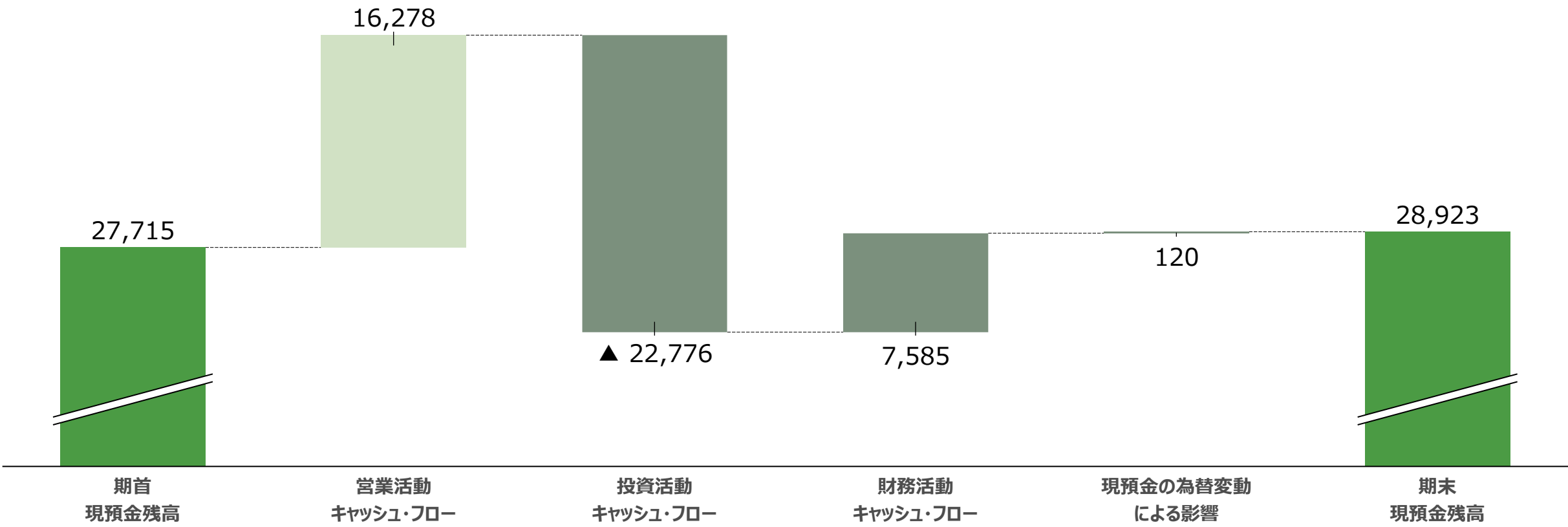
2025年9月末 資産・負債・資本

単位：百万円※	
総資産 187,368	
流動資産 68,666	流動負債 36,813
	非流動負債 19,452
非流動資産 118,702	資本 131,102
	(自己資本比率 70.0%)

- 税引前中間利益15,429百万円、減価償却費8,833百万円等により、営業キャッシュ・フローは+16,278百万円
- 有形固定資産の取得20,381百万円等により、投資キャッシュ・フローは▲22,776百万円
- 短期借入金の増加9,438百万円、リース負債の返済1,634百万円等により、財務キャッシュ・フローは+7,585百万円

2026年3月期上半期 キャッシュ・フロー

単位：百万円※



※百万円未満切り捨て

- 3Q以降も引き続き、中国以外のエリアでの成長やAdvancedノードにおける売上成長を背景に中計目標に対してインラインの水準で進捗する見通し

単位：百万円※

	2026年3月期上半期 (実績)	2026年3月期通期 (予想)	進捗率
売上収益	61,771	125,291	49.3%
営業利益	12,896	25,500	50.6%
税引前利益	15,429	25,915	59.5%
親会社の所有者に帰属する中 間利益	12,350	18,878	65.4%
為替レート(USD/JPY)	146.07円	140円 (想定)	

※百万円未満切り捨て

Appendix

	2025年3月期 第1四半期	2025年3月期 第2四半期	2025年3月期 第3四半期	2025年3月期 第4四半期	2025年3月期 通期	2026年3月期 第1四半期	2026年3月期 第2四半期	2026年3月期 第3四半期	2026年3月期 第4四半期	2026年3月期 通期
	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)
売上収益	29,811	29,705	29,811	28,646	117,974	30,076	31,695			
売上総利益	10,002	11,223	10,440	9,461	41,128	9,811	11,088			
売上総利益率	33.6%	37.8%	35.0%	33.0%	34.9%	32.6%	35.0%			
調整後営業利益	6,773	8,218	7,129	6,348	28,469	5,981	7,208			
調整後営業利益率	22.7%	27.7%	23.9%	22.2%	24.1%	19.9%	22.7%			
調整後四半期利益	4,503	8,693	7,846	3,559	24,601	5,549	7,005			
調整後親会社の所有者に 帰属する四半期利益	4,503	8,693	7,846	3,559	24,601	5,549	7,005			
EBITDAマージン	35.5%	39.3%	37.3%	36.8%	37.3%	33.8%	37.3%			
調整後EBITDAマージン	35.7%	39.5%	37.6%	37.2%	37.5%	34.2%	37.9%			
為替レート (USD/JPY)	158.24	146.52	154.20	151.15	152.57	143.75	148.34			

注：本資料には、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後営業利益、調整後当期純利益等、一定の当社のIFRS非準拠の財務指標が含まれている。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもない。

	2025年3月期 第1四半期	2025年3月期 第2四半期	2025年3月期 第3四半期	2025年3月期 第4四半期	2025年3月期 通期	2026年3月期 第1四半期	2026年3月期 第2四半期	2026年3月期 第3四半期	2026年3月期 第4四半期	2026年3月期 通期
	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)	日本円(百万円)
売上収益	29,811	29,705	29,811	28,646	117,974	30,076	31,695			
売上総利益	10,002	11,223	10,440	9,461	41,128	9,811	11,088			
売上総利益率	33.6%	37.8%	35.0%	33.0%	34.9%	32.6%	35.0%			
営業利益	6,726	8,152	7,065	6,255	28,199	5,875	7,020			
営業利益率	22.6%	27.4%	23.7%	21.8%	23.9%	19.5%	22.2%			
四半期利益	4,470	4,258	7,801	▲6,584	9,945	5,475	6,874			
親会社の所有者に帰 属する四半期利益	4,470	4,258	7,801	▲6,584	9,945	5,475	6,874			
研究開発費率	0.7%	0.9%	0.8%	0.4%	0.7%	0.9%	0.9%			
減価償却費率	12.5%	11.5%	13.2%	14.6%	12.9%	13.9%	14.7%			
為替レート (USD/JPY)	158.24	146.52	154.20	151.15	152.57	143.75	148.34			

本資料は、テクセンドフォトマスク株式会社（以下「当社」といいます。）の企業情報等の提供のために作成されたものであり、米国、日本国又はそれ以外の一切の法域における有価証券への投資に関する勧誘を構成するものではありません。米国、日本国又はそれ以外の一切の法域において、適用法令に基づく登録若しくは届出又はこれらの免除を受けずに、当社の有価証券の募集又は販売を行うことはできません。

本資料の作成にあたり、当社は当社が入手可能なあらゆる情報の真実性、正確性及び完全性に依拠し、前提としていますが、その真実性、正確性及び完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。本資料に記載された情報は、事前に通知することなく変更されることがあります。本資料及びその記載内容について、当社の書面による事前の同意なしに、第三者が、その他の目的で公開又は利用することはできません。本資料には、当社に関する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」というような表現や将来の事業活動、業績、出来事又は状況を説明するその他の類似した表現が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基に、本資料の作成時点における当社の経営陣の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提（仮定）の下になされています。そのため、これらの将来に関する記述又は前提（仮定）は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。したがって、これらの将来に関する記述に全面的に依拠することのないようご注意ください。なお、本資料に記載された情報は本資料の日付（又はそこに別途明記された日付）時点のものであり、新たな情報、将来の出来事やその他の発見に照らして、将来に関する記述を変更又は訂正する一切の義務を当社は負いません。

当社の現在の決算期は3月末であります。また、本資料に含まれる全ての財務情報は、別途記載のない限り、連結ベースであり、国際会計基準（以下「IFRS」といいます。）に準拠しています。

本資料には、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後営業利益、調整後当期純利益等、一定の当社のIFRS非準拠の財務指標が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。

本資料は、当社の企業情報等のご案内のみを目的として提供しています。本資料の複製は禁じられており、いかなる目的において又は方法によっても、他者に転送又は再配布してはなりません。本資料を提供するにあたり、当社は、追加情報へのアクセス手段、本資料の情報の更新、本資料に記載されている情報が不正確であることが明らかとなった場合の修正につき、一切責任を負いません。

当社は本資料の情報の利用により生じたいかなる損害に関し、一切責任を負うものではありません。

また、本資料に記載されている当社及び当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報又は第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について、当社は独自の検証を行っておらず、また、これを保証するものではありません。



<https://www.photomask.com>